مشخصه یابی سطحی و رفتار خوردگی آلیاژ مونل ۴۰۰ پس از فرآیند میکروساچمه پاشی پرانرژی رویا پلمه، صادق پورعلی، رضا توانگر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران سید سینا حجازی دانشگاه زیگن، آلمان

چکیدہ

در بررسی حاضر، ساختار سطحی و رفتار خوردگی آلیاژ مونل ۲۰۰ پس از فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی به صورت مقایسهای با همتای آنیل انحلالی شده آن مورد مقایسه قرار می گیرد. برای نیل به هدف این بررسی، آزمونهای سنجش میکروسختی و زبری، پراش پرتو ایکس سطحی (GI-XRD) میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM) جهت مشخصهیابی لایههای سطحی در نمونههای میکروساچمهپاشی شده و آنیل انحلالی شده به کار گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصله، فرآیند یاد شده باعث کاهش اندازه دانه سطحی از گستره حدود میکروساچمهپاشی شده و آنیل انحلالی شده به کار گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصله، فرآیند یاد شده باعث کاهش اندازه دانه سطحی از گستره حدود میکروساچمهپاشی شده و آنیل انحلالی شده به کار گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصله، فرآیند یاد شده باعث کاهش اندازه دانه سطحی از گستره حدود به به میکروساچمهپاشی شده و آنیل انحلالی شده به کار گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک چرخهای، مقایسه رفتار خوردگی سطوح آنیل و میکروساچمهپاشی شده نیز به کار گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک چرخهای، نمونه میکروساچمهپاشی شده در مقایسه با نمونه آنیل شده، چگالی جریان خوردگی اولیه بالاتری به بهای چگالی جریان رویینگی کمتر از خود نشان می-دهد. پتانسیل رویینگی مجدد برای نمونه میکروساچمهپاشی شده، حاصل از آزمون های بالاتری به بهای چگالی جریان رویینگی کمتر از خود نشان می-دهر برابر خوردگی موضعی است. بر اساس برازش داده های حاصل از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، مقاومت بالاتر ایس نمونه در برابر خوردگی موضعی است. بر اساس برازش داده های حاصل از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، مقاومت بالاتر ایس نمونه میکروساچمهپاشی شده بیش از دو برابر این مقدار برای نمونه آنیل انحلالی است.

واژههای کلیدی: آلیاژ مونل ۴۰۰، فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی، مشخصهیابی سطح، رفتار خوردگی

Surface characterization and corrosion behavior of Monel 400 after high energy micro-shot peening process

Abstract

In this study, the surface structure and corrosion behavior of Monel 400 alloy are comparatively investigated after high energy micro-shot peening process with its solution-annealed counterpart. To the aim of this investigation, microhardness and roughness measurements, grazing-incidence X-ray diffraction (GI-XRD), field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), and transmission electron microscopy (TEM) were employed to characterize the surface layers of high energy micro-shot peened and solution-annealed samples. Based on the results, the process decreases the surface grain size from 30 ± 4 µm to 76 ± 5 nm, and increases the density of dislocation structures on the surface. Moreover, electrochemical corrosion tests were carried out in HCl solution to compare the corrosion behavior of solution-annealed and micro-shot peened surfaces. Based on the results of the cyclic potentiodynamic polarization test, the micro-shot peened sample shows a higher initial corrosion current density at the expense of a lower passivity current density, as compared with the solution-annealed sample, which is a proof of the higher resistance of this sample against localized corrosion. Based on the fitting of the data obtained from the electrochemical impedance spectroscopy, the polarization resistance of the passive film in the micro-shot peened sample is more than twice of this one for the solution-annealed sample.

Key words: Monel 400 alloy, high energy micro-shot peening process, surface characterization, corrosion behavior **E-mail of Corresponding author:** *pourali@sut.ac.*

کوچک (نوعاً کمتر از ۲۵۰ μm و سختی کافی (۵۰HRC ~)) در اثر شتاب و انرژی بالا به سطح قطعه یا نمونه کاری برخورد كرده و سطح را تحت تغيير شكل پلاستيك موضعي قرار میدهند [۱۵]. با این حال، کارکرد این روش روی آلیاژ مونل مورد توجه قرار نگرفته است و کماکان عملکرد سطوح مونل پس از تغییر شکل پلاستیک شدید سطحی محل سوال است. مهمتر آن که با توجه به میل تمامی ناپذیر بشر برای دستيابي به مواد با عملكرد ايدهآل و طول عمر بالا، در حال حاضر تلاشها به منظور بهبود عملكرد مواد از طريق اصلاح اندازه دانه آنها نیز ادامه دارد (به طور خاص، تولید مواد با اندازه دانهبندی فوقریز و نانوبلوری). از آن جا که در این-گونه دانهبندیها (نانوبلوری/ فوقریز) درصد قابل توجهی از ریزساختار را فصل مشترکها تشکیل میدهند، کسر غالبی از اتمها نیز در مرزدانهها به سر میبرند [۱۶]. این موضوع دلیل اصلی تفاوت در خواص این دسته از مواد با همتایان آنها که دارای اندازه دانهای در گستره میکرومتر هستند، شناخته می-شود. تفاوتی که منجر میشود تا مواد نانوبلوری و فوق-ريزدانه، غالباً استحكام مكانيكي فزاينده، نفوذپذيري بالا، مقاومت به خوردگی الکتروشیمیایی بهتر (در عموم آلیاژها و محیطهای خورنده)، گرمای نهان و مقاومت الکتریکی بالاتر و خواص تریبولوژیکی مطلوبتر از خود نشان دهند [۱۷]. هدف بررسى حاضر، اعمال فرآيند ميكروساچمەپاشى پرانرژی به منظور فوق ریزدانه کردن سطح آلیاژ مونل ۴۰۰ و در ادامه مشخصهیابی سطح میکروساچمهپاشی شده و ارزیابی رفتار خوردگی آن به صورت مقایسهای با همتای آنیل انحلالی شده است.

مواد و روش تحقیق

ماده اولیه مورد استفاده در بررسی حاضر مقاطع استوانهای آلیاژ مونل ۴۰۰ به قطر ۱۰۰ mm بود که ترکیب شیمیایی این آلیاژ در جدول ۱ نشان داده شده است. ترکیب شیمیایی بر

در میان آلیاژهای فلزی مختلف، آلیاژهای پایه نیکل به عنوان موادی استراتژیک، جایگاهی ویژه از نظر اهمیت و کاربرد را به خود اختصاص دادهاند. مونل یک آلیاژ پایه نیکل حاوی حدود ۳۳ درصد وزنی مس است که در گستره وسیعی از کاربردها اعم از صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی، هستهای، نیروگاهی و دریایی مورد استفاده قرار میگیرد. مونل ۴۰۰، مونل K500 و مونل R-405 از جمله گریدهای صنعتی این آلیاژ محسوب می شوند. مقاومت به خوردگی عالی، خواص مکانیکی قابل قبول، مقاومت به حرارت و اکسیداسیون و استحکام خزشی مطلوب از جمله پیشنیازهای کارکردی برای این آلیاژ شناخته میشوند [۳–۱]. اگرچه آلیاژهای مونل مقاومت به خوردگی مطلوبی در محیطهای اسیدی و دریایی از خود نشان میدهند، اما در محیطهای آلوده به کلراید به شدت مورد حمله موضعی کلرایدی قرار می گیرند که همین امر نیاز به مهندسی سطح این آلیاژ را دو چندان میکند [۴]. تاکنون روشهای مهندسی سطح نظیر بوردهی [۵]، نیتروژن-دهی [۶] و کربندهی [۷] برای بهبود عملکرد سطحی و خوردگی آلیاژهای مونل پیشنهاد شدهاند. تمام این روشها در زمره راهکارهای مهندسی سطح که با تغییر ترکیب شیمیایی سطح همراه هستند، قرار می گیرند. در سالیان اخیر روشهای تغيير شكل پلاستيک شديد سطحي که صرفاً با تغيير ریزساختار سطح (به طور خاص، ریزدانگی) منجر به بهبود خواص سطحی و مقاومت به خوردگی می شوند، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. از جمله روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید سطحی، می توان به ساچمه پاشی پرانرژی [۸]، سایش اصطكاكي [٩]، ساچمەپاشىاولتراسونيك [١٠]، سنگزنى مکانیکی سطح [۱۱] و لیزرپینینگ [۱۲] اشاره کرد. در این میان، روش ساچمهپاشی پرانرژی به دلیل مزایای قابل توجه آن به شدت در صنعت مورد استفاده قرارگرفته و توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است [۱۳،۱۴]. این روش یک عملیات مکانیکی سطحی است که در آن گویهای

مقدمه

شماره ۶۰۰ قرار گرفتند. بدینسان، با ایجاد زبری مشابه روی هر دو نمونه میکروساچمهپاشی شده و آنیل شده، اثرات احتمالی ناشی از زبری کمینه شد. جهت بررسی فازهای موجود در لایههای سطحی نمونهها، آنالیز GI-XRD بر سطح نمونههای آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده انجام شد. برای این منظور زاویه سطحی ۲° با تابش cu ka استفاده شد. همچنین متوسط اندازه کریستالیت با استفاده از رابطه ۱ یعنی معادله ویلیامسون-هال^۲ [۲۰] تعیین شد.

$$\beta_r \cos \theta = \left(\frac{k\lambda}{D}\right) + \mu \sin \theta \tag{1}$$

$$\beta_r = \sqrt{\beta_i^2 - \beta_0^2} \tag{(Y)}$$

در رابطه (۱)، D اندازه کریستالیت، k فاکتور شرر که معمولاً در نظر گرفته می شود، μ معرف کرنش، λ وheta به ترتیب /۹ طول موج پرتو ایکس و زاویه براگ هستند. β_r که مربوط به یهن شدن پیک پراش در نتیجه فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی است برابر است با رابطه (۲) که در آن eta_i و eta_0 به ترتيب برابر با عرض پيک در نصف ارتفاع^۳ آن (FWHM) برای نمونههای میکروساچمهپاشی شده و آنیل انحلالی هستند. آزمون میکروسختی نیز در مقاطع عرضی نمونهها بعد از عملیات میکروساچمهپاشی پرانرژی انجام شد. افزون بر این، میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی (-FE SEM, MiraTescan 3) و ميكروسكوپي الكتروني عبوري (Tecnai G2) نیز جهت مشخصهیابی سطح میکروساچمه-یاشی شده و نمونه آنیل انحلالی به کار گرفته شد. آمادهسازی نمونههای TEM با روشی که در منبع [۱۹] آمده است، انجام شد. در پایان، رفتار خوردگی سطوح کار شده و آنیل در محلول اسید کلریدریک (HCl, Merck) ۱ مولار با استفاده از آزمونهای پتانسیل مدار باز، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک اساس طیفسنجی نشر نوری (Solaris CCD Plus-Spectro) به دست آمده است. در ابتدا برای حذف تنشهای پسماند موجود و همگنسازی ترکیب شیمیایی، این آلیاژ در دمای C^o روب ۷۶۰ به مدت ۲ ساعت تحت عملیات آنیل انحلالی قرار گرفت و سپس در آب کوئنچ شد [۱۸]. سطح این نمونهها طی سنبادهزنی (از شماره ۳۲۰ تا ۲۰۰۰) و پولیش با خمیر شد. به منظور بررسی ریزساختار اولیه حالت آنیل، نمونهها شد. به منظور بررسی ریزساختار اولیه حالت آنیل، نمونهها شده، اس ۲۵ اسید کلریدریک (/۳۷)، اس ۱۰ الکل صنعتی شده، اس ۲۵ اسید کلریدریک (/۳۷)، اس ۱۰ الکل صنعتی (/۹۸) اچ شدند. در ادامه، نمونههای مکعبی به ابعاد اس (۹۸۸) ای شان آلیاژ تهیه شدند.

پس از این مرحله، یک سری از نمونههای آنیل شده، تحت عملیات میکروساچمهپاشی پرانرژی قرار گرفتند که شماتیک فرآیند در شکل ۱ نشان داده شده است. برای این منظور ساچمههای استاندارد سرامیکی (Al₂O₃) با سختی متوسط فشرده با سطح نمونهها برخورد کردند. زاویه برخورد فشرده با سطح نمونهها برخورد کردند. زاویه برخورد ساچمهها با سطح و فاصله نازل تا سطح به ترتیب برابر با م⁹ ۹۰ و mm ۲۰۰ در نظر گرفته شدند. قطر نازل mm نقد و فلوی جرمی ساچمهها در حدود MPa نید و فشار هوا نیز حدود MPa شد و فشار هوا نیز حدود ماکم شده با زبری مشابه با نمونههای میکروساچمهپاشی شده، نمونههای آنیل نیز قبل از هر گونه بررسی ریزساختاری و نمونههای آنیل نیز قبل از هر گونه بررسی ریزساختاری و نمونههای آنیل نیز قبل از هر گونه بررسی ریزساختاری و

۲. Williamson-Hall

r. Full Width at Half Maximum (FWHM)

^{1.} Surface Coverage

الکتروشیمیایی، آلیاژ مونل ۴۰۰ در دو حالت آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده به عنوان الکترود کاری، الکترود Ag/AgCl به عنوان الکترود مرجع و الکترود پلاتین نیز به عنوان الکترود کمکی انتخاب شدند. آزمونهای الکتروشیمیایی در دمای اتاق و اتمسفر هوای آزاد انجام شدند. این آزمونها حداقل سه بار برای حصول دادههای تجدیدپذیر تکرار شدند. چرخهای و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) با دستگاه پتانسیواستات PalmSens4 بررسی شد. پتانسیل مدار باز برای ۱۸۰۰ ثانیه تا رسیدن به مقدار پایدار ثبت شد. آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک چرخهای نیز با نرخ ۱۳۷۶ در بازه ۲۵۰ mV- نسبت به پتانسیل مدار باز تا مقدار مطلق بازه ۲۵۰ mV جنبال شد. این آزمون با روبش پتانسیل در جهت کاتدی تا رسیدن به تقاطع با شاخه آندی اولیه ادامه AC بازمون SIS در پتانسیل مدار باز و در دامنه ولتاژ برابر با ۲۰ mV انجام شد. به منظور تحلیل کمی نتایج این آزمون از نرمافزار ZView استفاده شد. در آزمونهای



جدول ۱. ترکیب شیمیایی آلیاژ مونل ۴۰۰ مورد استفاده در این بررسی (درصد وزنی)

شکل ۱. طرحواره فرآیند میکروساچمه پاشی پرانرژی.

نتايج و بحث

شکل۲-الف نتایج میکروسکوپی نوری از ریزساختار آلیاژ مونل۴۰۰، پس از عملیات آنیل انحلالی را نشان میدهد. همان گونه که از این شکل برمیآید، ریزساختارآلیاژ مونل

۴۰۰، متشکل از دانههای هممحوری است که در سرتاسر ساختار توزیع شدهاند. با توجه به این که هر دو عنصر اصلی تشکیل دهنده این آلیاژ (نیکل و مس) دارای ساختار FCC هستند و حلالیت آنها نیز در یک دیگر به صورت کامل است، می توان ادعا نمود که ریزساختار این آلیاژ شامل فاز ۱۲ عقیلی و همکاران، تأثیر آلایش فلوئور بر مقاومت به خوردگی، علوم و مهندسی سطح ۵۵ (۱۴۰۲)

نابجاییها در آن مشخص است. الگوی پراش الکترونی (SAED) در این حالت، به صورت نقاطی منظم حول نقطه مرکزی هستند که این نشاندهنده یک بلور کامل FCC است. شکل ۲-د نیز متوسط اندازه دانههارا نشان میدهد که بر اساس خروجی نرمافزار ImageJ، این مقدار برابر با μm زمینه γ (محلول جامد نیکل) است. از طرفی، نتایج حاصل از آزمون GI-XRD در شکل ۲–ب نیز حضور فاز گاما را تایید میکنند و بر اساس استاندارد ASTM B975، مونل ۴۰۰ دارای صفحات پراش (۱۱۱)، (۲۰۰) و (۲۲۰) است. شکل ۲-ج تصویر TEM از فوقانیترین سطح نمونه مونل ۴۰۰ آنیل انحلالی را نشان میدهد که چگالی بسیار پایین خطوط



شکل ۱. مشخصههای ریزساختاری نمونه مونل ۴۰۰ در حالت آنیل انحلالی: (الف) تصویر متالوگرافی، (ب) الگوی پراش پرتو ایکس سطحی، (ج) تصویر متناظر با آن و (د) منحنی توزیع اندازه دانه متناظر با تصویر الف.

اندازه دانه در سطح فوقانی و افزایش تدریجی این پارامتر از سطح تا لایههای زیرسطحی تا رسیدن به اندازه دانه حالت آنیل (قبل از میکروساچمهپاشی پرانرژی) را نشان میدهد مشخصههای ریزساختاری نمونه مونل ۴۰۰ پس از فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی در شکل ۳ نشان داده شده است. نتایج میکروسکوپی نوری مقطع این آلیاژ به وضوح کاهش ریزساختار سطح مشاهده می شود. این موضوع، در الگوی SAED متناظر که تشکیل شبه حلقه ها را نشان می دهد نیز آشکار است. بر اساس تصویر TEM میدان تیره در شکل ۳-ج، دانه ها (مراکز پراش) به صورت روشن مشاهده می شوند. توزیع اندازه دانه با تحلیل تصاویر میدان تیره در نرم افزار ImageJ به دست آمده و متوسط اندازه دانه nm ۵±۷۶ محاسبه شد (شکل ۳-د). (شکل ۳-الف). نمونه تصاویر TEM میدان روشن و میدان تیره نیز به ترتیب در شکل ۳- ب و ۳- ج نشان داده شدهاند. مطابق شکل۳-ب، تنش وارده به سطح در اثر فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی با پایش سطحی ۱۰۰۰٪، سبب پدیدار شدن کسر قابل توجهی از نابجاییها در سطح و بروز ساختارهای مختلف نابجاییها اعم از دیوارهها و جنگلهای نابجاییها میشود و هم چنین ساختار نانوبلورین در



شکل ۳. (الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع نمونه مونل ۴۰۰ پس از میکروساچمهپاشی پرانرژی، (ب) تصویر TEM میدان روشن و الگوی SAED متناظر با آن، (ج) تصویر TEM میدان تیره و (د) منحنی توزیع اندازه دانه پس از فرآیند میکرو ساچمهپاشی پرانرژی.

شدهاند. پهن شدن قابل توجه پیک گاما (γ) در الگوی پراش نمونه میکروساچمهپاشی شده مشهود است. بر اساس رابطه الگوهای پراش پرتو ایکس سطحی نمونههای مونل ۴۰۰ آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده در شکل ۴-الف نشان داده

(۱)، این پهن شدن را میتوان به ریزدانه شدن و افزایش میکروکرنش در لایههای سطحی نسبت داد. شکل ۴-ب نتیجه تحلیل ویلیامسون-هال برای سطح فوقانی نمونه میکروساچمهپاشی شده است که اندازه کریستالیت سطحی در این نمونه حدود mn ۳±۵۸ برآورد شد. به طور کلی -GI Iین نمونه عدود است اندازه کریستالیتهایی با عدم انطباق XRD قابلیت تشخیص اندازه کریستالیتهایی با عدم انطباق

مرزدانهای بسیار کم را دارد. این در حالی است که در محاسبه اندازه دانه از طریق تصاویر TEM اندازه متوسط دانهها مربوط به مرزهای با عدم انطباق بزرگتر است [۲۱]. از این رو، اندازه دانه محاسبه شده از روش ویلیامسون-هال کوچکتر از روش TEM است.



شکل ۴. (الف) الگوی پراش پرتو ایکس سطحی برای نمونه مونل ۴۰۰ آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده و (ب) آنالیز ویلیامسون- هال از سطح نمونه میکروساچمهپاشی شده.

عملیات میکروساچمه پاشی پرانرژی به حدود HV ۲۰۰ افزایش می یابد. ضخامت ناحیه متاثر از فر آیند میکروساچمه پاشی پرانرژی در محدوده ۲۹ ۱۲۰–۱۴۰ است که در شکل ۵ نیز نشان داده شده است. همان گونه که در تصاویر SEM نیز قابل مشاهده است، مرز جدایش مشخصی بین ناحیه سطح تغییر شکل یافته و زمینه آلیاژ وجود دارد که هم سو با یک تفاوت قابل توجه در ریز ساختار بالا و پایین مرز است. همان طور که از نمودار تغییرات میکروسختی نمونه آنیل انحلالی و نمونه میکروساچمه پاشی شده از سطح کار شده تا عمق (شکل ۴-الف) برمی آید، سطح فوقانی بیشترین مقدار سختی را به خود اختصاص داده است. با حرکت به سمت لایه های زیرین این پارامتر به تدریج کاهش یافته و در نهایت به سختی زمینه می رسد. هر نقطه در نمودار با انجام حداقل سه بار اندازه گیری به صورت میانگین گزارش شده و عدم قطعیت میانگین با سطح اطمینان ۹۵٪ به دست آمده است. جدول ۲ پارامترهای زبری دو نمونه آنیل انحلالی میکروساچمهپاشی شده را ارائه میکند: R_a (زبری متوسط، میانگین عددی از مقادیر اندازه گیری شده)، R_t (زبری کل، فاصله مرتفعترین قله تا عمیقترین دره) و R_z (میانگین عمق زبری). همان گونه که از دادههای این جدول برمیآید، هر دو نمونه مقادیر تقریباً مشابهی را نشان میدهند. در واقع، شرایط زبری سطح آنیل به گونهای انتخاب شد که اثر زبری ناشی از فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی در هر دو حالت تقریبا یکسان باشد تا رفتار خوردگی دو نمونه صرفاً با متغیر اندازه دانه در دو حالت آنیل انحلالی و میکروساچمه پاشی ارزیابی شود.

جدول ۲. پارامترهای زبری دو نمونه آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده (بر حسب میکرومتر)

Rz	R _t	R _a	نمونه
۱۸/۱±۱/۷	11/0±1/0	۳/۶±•/۵	أنيل انحلالي
71/1±1/1	۳۴/۲±۱/۸	۴/۵±۰/۶	ميكروساچمەپاشى شدە

منحنی تغییرات پتانسیل مدار باز برای نمونههای آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده در محلول ۱ مولار IHC در شکل ۶-الف نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن هستند که در هر دو نمونه، با شروع غوطهوری، روند تغییرات پتانسیل به صورت حرکت در جهت پتانسیلهای کاتدی تر است. با این حال، نمونه میکروساچمهپاشی شده شیب تغییرات شدیدتری را از خود نشان می دهد که این موضوع را می توان به رفتار فعال تر این نمونه در نتیجه حضور چگالی بالاتری از عیوب بلوری در سطح آن نسبت داد. با رسیدن به زمانهای حدود ثانیه در نمونه آنیل محلولی روند تغییرات پتانسیل تغییر کرده و این موضوع با حرکت به سمت پتانسیلهای آندی دنبال می شود که این تغییرات در پتانسیل را می توان به تشکیل فیلم علت افزایش میکروسختی در لایههای سطحی را میتوان بر اساس ترکیب روابط هال- پچ و تیلور ⁽[۲۲] (رابطه ۳) توجیه نمود.

$$\sigma_{y} = \sigma_{0} + \frac{K}{\sqrt{d}} + \alpha G b \rho b^{1/2} \tag{(7)}$$

که در آن، σ_y استحکام تسلیم، σ_0 تنش اصطکاکی، K ثابت هال– پچ، b اندازه دانه، α ثابت هندسی (۲/۰– ۱/۰)، Gمدول برشی، d بردار برگرز و ρ چگالی نابجایی ها است. با کاهش اندازه دانه و افزایش چگالی مرزدانه ها، سدهای موجود بر سر راه نابجایی های فعال افزایش یافته و از این طریق لغزش آن ها با موانع بزرگتری مواجه می گردد. از جمله پیامدهای این موضوع، افزایش سختی و استحکام است.



شکل۵. (الف) نمودار تغییرات میکروسختی در مقطع عرضی نمونه مونل ۴۰۰ میکروساچمهپاشی شده و (ب)، (ج) و (د) تصویر SEM متناظر با اَن در بزرگنماییهای متفاوت.

1. Taylor's Relation

جوانهزنی فاز ثانویه (نظیر اکسیدها و هیدروکسیدهایی که در باعث رویینگی میشوند) هستند؛ واقعیاتی که با افزایش چگالی جریان خوردگی اولیه و کاهش چگالی جریان رویینگی در ادامه پلاریزاسیون همراه هستند.



شکل ۲. (الف) منحنی تغییرات پتانسیل مدار باز و (ب) منحنی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک چرخهای برای دو نمونه آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده

روی سطح نمونهها نسبت داد [۲۳]. بعد از گذشت حدود ۱۰۸۰ ثانیه در هر دو نمونه پتانسیل به صورت پایدارتری تغيير ميكند كه اين موضوع مي تواند به دليل تشكيل فيلم یکپارچه روی سطح نمونهها باشد. بر اساس دادههای کمی حاصل از این آزمون مقدار پتانسیل مدار باز پس از ۱۸۰۰ ثانیه در نمونه میکروساچمهپاشی شده mV vs. Ag/AgCl ۸۰- و در نمونه آنیل محلولی mV vs. Ag/AgCl-است؛ به عبارت دیگر، نمونه میکروساچمهپاشی شده رفتار نجيب ترى از خود نشان مىدهد. نتايج آزمون پلاريزاسيون پتانسیودینامیک چرخهای برای دو نمونه آنیل محلولی و میکروساچمه پاشی شده نیز در شکل ۶–ب نشان داده شده است. چرخه برگشت پتانسیل در این آزمون می تواند مبین میزان مقاومت در برابر خوردگی موضعی باشد. افزون بر این، جدول ۳ نیز دادههای متناظر با شکل ۶–ب را ارائه میکند. مقادیر چگالی جریان خوردگی (icorr) و یتانسیل خوردگی (Ecorr) از روش برونیابی تافل [۲۴] به دست آمدهاند. اگرچه هر دو نمونه رفتارهای نسبتاً یکسانی در شاخه کاتدی نشان میدهند اما در شاخه آندی رفتار کاملا متفاوتی بروز میدهند. آنچنان که از این شکل و جدول ۳ برمی آید، نمونه میکروساچمه پاشی شده در مقایسه با نمونه آنیل محلولی چگالی جریان خوردگی بالاتری دارد و این به آن معنا است که حضور فزاینده مسیرهای پرانرژی (عیوب بلوری) در سطح نمونه کار شده باعث افزایش چگالی جریان خوردگی اوليه در اين نمونه شده است. با اين حال، اين سرعت اوليه بالاتر به بهای تشکیل یک فیلم رویین با حفاظت بیشتر (ip: چگالی جریان رویینگی کمتر) خواهد بود. رفتار مشابهی در خصوص فولادهای زنگنزن نیز توسط برخی از محققین مشاهده شده است [۲۵]. از جمله دلایلی که برای این مهم ذکر شده است، افزایش سهم عناصر رویین کننده در فیلم سطحی حاصل از واکنش های خوردگی و افزایش مکان های

شکل ۷ نتایج آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی را برای نمونههای آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده را نشان میدهد. این نتایج در سه قالب رایج منحنیهای نایکویست (شکل ۷–الف)، اندازه بُد (شکل ۷–ج) و بُد فاز (شکل ۷–د) ارائه شدهاند. منحنیهای نایکویست برای هر دو نمونه یک حلقه و منحنیهای بد فاز نیز یک پیک را نشان میدهند؛ این به آن معنا است که واکنشهای خوردگی تک ثابت زمانه هستند. بیشتر بودن شعاع حلقههای نایکویست، مقدار امپدانس در فرکانس Hz ۱۰/۰ و پهنتر بودن منحنی فاز در فرکانسهای میانی (Hz ۱۰۰۰–۱) برای نمونه میکروساچمهپاشی شده مبین بالاتر بودن مقاومت به خوردگی این نمونه در محلول ۱ مولار HCI است.

	<u> </u>		
<i>E</i> _{rep} (mVAg/AgCl)	<i>E</i> _{corr} (mVAg/AgCl)	$i_{\rm corr}$ (μ A/cm ²)	نمونه
۸۱۲	-743	۲/۵	أنيل انحلالي
٩۶٣	-191	V/V	میکروساچمه- پاشی شده

جدول۳. پارامترهای خوردگی مستخرج از شکل ۶-ب

نکته دیگری که توجه به آن ضرورت دارد، مقادیر Erep (پتانسیل بازرویینگی) در روبش معکوس پتانسیل در شاخه آندی هستند. بر اساس منابع [۲۶]، افزایش این پارامتر به سمت مقادیر آندیتر، همسو با افزایش مقاومت در برابر خوردگی موضعی است. با توجه به این که این پارامتر برای نمونه میکروساچمهپاشی شده حدود No· mV vs. Ag/AgCl این مثبتتر است، میتوان ادعا نمود که مقاومت این نمونه در برابر حمله خوردگی موضعی نیز بیشتر است.



شکل ۷. نتایج آزمون طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای نمونههای مختلف. (الف) دیاگرامهای نایکویست، (ب) مدار معادل متناظر برای برازش دادهها، (ج) منحنیهای اندازه بُد و (د) نمودارهای بُد فاز.

فرآیند میکروساچمهپاشی پرانرژی سطحی با پایش ۱۰۰۰٪ بر سطح آلیاژ مونل ۲۰۰ انجام شد. ریزساختار و رفتار خوردگی نمونههای میکروساچمهپاشی شده و آنیل انحلالی در شرایط زبری یکسان به صورت مقایسه مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: (الف) این فرآیند سبب کاهش اندازه دانه سطحی تا گستره m Δ±۶۷ و افزایش چگالی ساختارهای نابجاییها میشود. (ب) این فرآیند باعث افزایش قابل توجه میکروسختی در لایه سطحی از مقدار متوسط HV تا حدود HV میشود. افزون بر این، ضخامت لایه سطحی کار شده حدود (ج) ریزساختار متمایزی در تصاویر سطح مقطعی از لایه سطحی کار شده و نواحیِ زیرین ایـن لایـه در نمونـه میکروساچمه پاشی شده مشاهده شد.

(د) چگالی جریان خوردگی اولیه برای نمونه آنیل انحلالی و میکروساچمه پاشی شده به ترتیب برابر با μA/cm² و ۷/۷ μA/cm² برآورد شد. افزایش چگالی جریان خوردگی در نمونه دوم، به بهای تشکیل فیلم رویینی با چگالی جریان رویینگی کمتر است. (ه) بر اساس دادههای دادههای طیفسنجی امپدانس

الکتروشیمیایی، مقاومت پلاریزاسیون فیلم رویین در نمونه آنیل انحلالی و میکروساچمهپاشی شده به ترتیب برابر با ۲۶/۵ kΩ.cm² و ۶۱/۱ kΩ.cm² به دست آمد.

مراجع

- [1] J.R. Davis, Nickel, cobalt, and their alloys, ASM international, 2000.
- [2] M. Nallusamy, M. Suriyaprakash, and K. Kiran, Experimental investigations on mechanical properties and microstructure of TIG welded monel 400 alloys, Materials Today Proceeding 62 (2022) 2261–2265.
- [3] L.E. Shoemaker, and G.D. Smith, *A century* of monel metal: 1906–2006, JOM. 58 (2006) 22–26.
- [4] S. Metals, High-performance alloys for

به منظور تحلیل کمّی داده های این آزمون، نتایج حاصله با به کارگیری مدار معادل نشان داده شده در شکل ۷-ب برازش و داده های به دست آمده نیز در جدول ۴ ارائه شدند. در این مدار، R_s و R_p به ترتیب مقاومت محلول و مقاومت پلاریزاسیون هستند. در حقیقت، Rp مقاومت فیلم سطحی در برابر انحلال است. این پارامتر نه تنها شامل مقاومت انتقال بار است بلكه مقاومت تكلايههاي سطحي موجود در فصل مشترک آلیاژ /محلول را نیـز در برمـیگیـرد [۲۷]. افزون بر این، Q نیز عنصر فاز ثابت است که ویژگی-های خازنی یک فصل مشترک غیرایده آل را مدل می کند. این پارامتر از دو بخش Y₀ و n تشکیل شده است که به ترتیب ادمیتانس عنصر فاز ثابت و پارامتر مربوط به میزان انحراف از یک خازن ایدهآل هستند (n = ۱ یعنی خازن ايده آل است). مقدار Rp برای نمونه ميکروساچمه پاشي شده بیش از دو برابر بزرگتر از نمونه آنیل انحلالی است که این موضوع به وضوح به معنای مقاومت بالاتر فیلم سطحی آن در برابر انحلال و خوردگی است. افزون بر آن، مقدار کمتـر Y₀ برای نمونه میکروساچمهپاشی شده نیز منعکس کننده عیوب بلوری کمتر برای فیلم سطحی موجود بر سطح این نمونه است. مدار معادل پیشنهادی در این بررسی در توافق با یافتههای حاصل از اویانگ و همکاران [۲۷] است.

جدول ۴. پارامترهای خوردگی مستخرج از دادههای طیفسنجی امیدانس الکتر و شیمیایی

Q		R _p	Rs	. · ·				
	n	$\frac{Y_0}{(10^{-4}\mathrm{S}\cdot\mathrm{cm}^{-2}\cdot\mathrm{s}^{-n})}$	$(k\Omega.cm^2)$	$(\Omega.cm^2)$	ىمونە			
	• /VA	۶/۵	۲۶/۵	11/7	أنيل انحلالي			
	•/٧۴	•/40	۶١/١	17/4	ميكروساچمه-			
				پاشى شدە				

نتيجه گيري

the calculated stacking fault energy and the plasticity mechanisms in Fe-Mn-C alloys, Materials Science and Engineering A 387 (2004) 158-162.

- [16] C. Suryanarayana, Structure and properties of nanocrystalline materials, Bulletin of Materials Science 17 (1994) 307-346.
- [17] C. Suryanarayana, and C.C. Koch, Nanocrystalline materials–Current research and future directions, Hyperfine Interact. 130 (2000) 5–44.
- [18] A.R. Paul, M.C. Naik, and K.N.G. Kaimal, Mass transport of Chromium and Nickel in Monel-400, Journal of Nuclear Materials 58.2 (1975) 205-210 J.
- [19] S. Pour-Ali, A.-R. Kiani-Rashid, A. Babakhani, S. Virtanen, and M. Allieta, Correlation between the surface coverage of severe shot peening and surface microstructural evolutions in AISI 321: A TEM, FE-SEM and GI-XRD study, Surface and Coatings Technology 334 (2018) 461-470.
- [20] J.C. Villegas, and L.L. Shaw, Nanocrystallization process and mechanism in a nickel alloy subjected to surface severe plastic deformation, Acta Materialia 57.19 (2009) 5782-5795
- [21] M. Hassani, K.S. Cho, H.-J.L. Voigt, M. Guagliano, and C. Schuh, Experimental assessment and simulation of surface nanocrystallization by severe shot peening, Acta Materialia 97 (2015) 105-115.
- [22] C. Ye, A. Telang, A.S. Gill, S. Suslov, Y. Idell, K. Zweiacker, J.M.K. Wiezorek, Z. Zhou, D. Qian, S.R. Mannava, and V.K. Vasudevan, Gradient nanostructure and residual stresses induced by Ultrasonic Nano-crystal Surface Modification in 304 austenitic stainless steel for high strength and high ductility, Materials Science and Engineering: A 613 (2014) 274-288.
- [23] S. Pour-Ali, A. Kiani-rashid, A. Babakhani, and A. Davoodi, Enhanced protective properties of epoxy/polyaniline-camphorsulfonate nanocomposite coating on an ultrafinegrained metallic surface, Applied Surface Science 376 (2016) 121–132.
- [24] E. McCafferty, Introduction to corrosion science. Springer Science & Business Media, 2010.
- [25] K.D. Ralston and N. Birbilis, Effect of grain size on corrosion: a review, Corrosion 66 (2010) 075005-075005.
- [26] E. Bettini, C. Leygraf, and J. Pan, *Nature of current increase for a CoCrMo alloy:*

resistance to aqueous corrosion, SM Aqueous Corrosion Book 28 (2000) 68.

- [5] A.P. Krelling, F.S. Melo, E.A.S. Almeida, C.E. Da Costa, and J.C.G. Milan, *Microstructure and properties of borided Monel 400 alloy*, Materials Research. Express. 6 (2019) 106410.
- [6] M.M. Ghorbani, R. Taherian, and M. Bozorg, Investigation on physical and electrochemical properties of TiN-coated Monel alloy used for bipolar plates of proton exchange membrane fuel cell, Materials Chemistry and Physics 238 (2019) 121916.
- [7] K. Jahns, A.S. Ulrich, C. Schlereth, L. Reiff, U. Krupp, and M.C. Galetz, *The Effect of Cu Content and Surface Finish on the Metal Dusting Resistance of Additively Manufactured NiCu Alloys*, Oxidation of Metals 96 (2021) 241-256.
- [8] J. Zheng, K. Li, Y. Zhang, K. Zhan, Z. Yang, B. Zhao, Z. Wang, and V. Ji, Surface characteristic and corrosion resistance of different plasma-sprayed coatings (Zn, Al6061and Zn/23Al) on S960 high strength steel with subsequent micro-shot peening, Surface and Coatings Technology 451 (2022) 129046.
- [9] D.A. Hughes, and N. Hansen, Graded Nanostructures Produced by Sliding and Exhibiting Universal Behavior, Physical Review Letters 87.13 (2001) 135503.
- [10] Y. Chen, J. Du, S. Deng, L. Tian, and K. Hu, Effect of ultrasonic shot peening duration on the microstructure and mechanical properties of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Journal of Alloys and Compounds 934 (2023) 168023.
- [11] W.L. Li, N.R. Tao, and K. Lu, Fabrication of a gradient nano-micro-structured surface layer on bulk copper by means of a surface mechanical grinding treatment, Scripta Materialia 59.5 (2008) 546-549.
- [12] X. Zhang, M. Yang, C. Zhou, N. Fu, W. Huang, and Z. Wang, A comprehensive review of fatigue behavior of laser shock peened metallic materials, Theoretical and Applied Fracture Mechanics (2022) 103642.
- [13] B. Altan, Severe plastic deformation: toward bulk production of nanostructured materials, Nova Publishers, 2006.
- [14] M. Wen, G. Liu, J. Gu, W. Guan, and J. Lu, Dislocation evolution in titanium during surface severe plastic deformation, Applied Surface Science 255.12 (2009) 6097-6102
- [15] S. Allain, J.-P. Chateau, O. Bouaziz, S. Migot, and N. Guelton, *Correlations between*

- "transpassive" dissolution vs. water oxidation, International Journal of Electrochemistry Science 8 (2013) 11791–11804.
- [27] M. Ouyang, J. Pan, F. Cai, C. Wang, H. Liu, J. Li, and X. Xiao, Corrosion behaviour of super ferritic stainless steel 020Cr25MoCuNbTi in the waste phosphoric acid of a surface treatment process, Corrosion Science 212 (2023) 110921.